



# 제25회 한국반도체학술대회

The 25<sup>th</sup> Korean Conference on Semiconductors

2018년 2월 5일(월)-7일(수), 강원도 하이원리조트 컨벤션 호텔

2018년 2월 6일(화), 09:00-10:45

Room K (육백II, 6층)

## Q. Metrology, Inspection, and Yield Enhancement 분과

### [TK1-Q] Metrology & Inspection

TK1-Q-1 09:00-09:15	<b>TSOM Image Measurement with Iterative MSD Computations</b> Youngback Kim, Junhee Jeong, Joonghwee Cho <i>Department of Embedded Systems Engineering, Incheon National University</i>
TK1-Q-2 09:15-09:45	<b>[초청]</b> <b>MI Tech vs Litho Tech</b> Byoung Ho Lee <i>SK Hynix</i>
TK1-Q-3 09:45-10:15	<b>[초청]</b> <b>Next Generation Automated Industrial AFM and Its Applications in Semiconductor Technology</b> Byoung-Woon Ahn, Ahjin Jo, Seong-Hun Yun, Ju Suk Lee, Tae-Gon Kim, Sang-Joon Cho <i>R&amp;D Department, Park Systems Corp.</i>
TK1-Q-4 10:15-10:30	<b>Development of Novel EUV Actinic Inspection Technique : EUV Scanning Lensless Imaging (ESLI)</b> 우동곤 <sup>1</sup> , 김영웅 <sup>1</sup> , 김정환 <sup>1</sup> , 신승혁 <sup>2</sup> , 김희울 <sup>2</sup> , 안진호 <sup>1,3</sup> <i><sup>1</sup>한양대학교 신소재공학과, <sup>2</sup>한양대학교 전자컴퓨터통신 공학과, <sup>3</sup>나노과학기술연구소</i>
TK1-Q-5 10:30-10:45	<b>반도체 제조산업의 기술 한계 극복을 위한 진단센서 기반의 플라즈마 공정 및 오염입자 발생 측정연구</b> 송제범 <sup>1,2</sup> , 이승수 <sup>1</sup> , 김민중 <sup>1</sup> , 소종호 <sup>1</sup> , 오성근 <sup>2</sup> , 정낙관 <sup>1</sup> , 김진태 <sup>1</sup> , 윤주영 <sup>1</sup> <i><sup>1</sup>한국표준과학연구원, <sup>2</sup>한양대학교</i>